

高度研所属学生の藤野貴大君

国際会議 Photomask Japan 2015 にて

「Best Academic Poster Presentation 賞」を受賞

高度研所属学生の藤野貴大君が 2015/4/20-4/22 に開催された国際会議 Photomask Japan 2015 にて「Best Academic Poster Presentation 賞」を受賞しました。

Photomask Japan は半導体原板のフォトマスク開発に携わる企業、要素技術の開発を進める大学や研究所が一同に集まり、成果を発表する国際会議です。発表内容は SPIE の Proceeding として公表されます。

藤野君はコヒーレント EUV 光を利用した顕微鏡を開発しています。光源には従来ニュースバル放射光施設を利用していましたが、顕微鏡の実用化のためレーザー励起の高次高調波を採用しました。今回は光学系の改造により、利用光量を 130 倍に高め、欠陥検出時間を千分の 1 に短縮できたことが大きな成果です。

この賞を励みに、EUV リソグラフィーの実用化につながる研究を続けたいとコメントしています。

